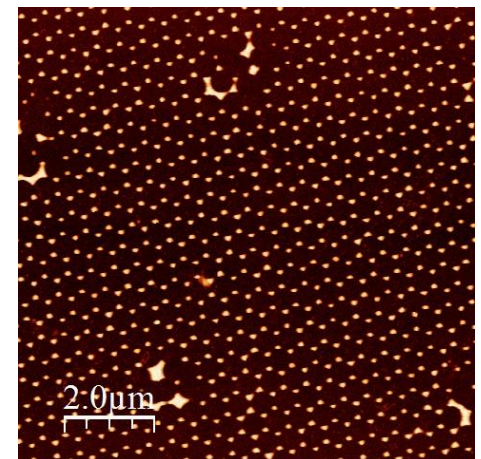
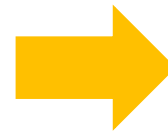


Die Schatten-Nanosphären-Lithographie ist eine wichtige Methode um Oberflächen langreichweitig, periodisch zu strukturieren. Dabei werden Polystyrol-Nanosphären hexagonal packend als Schattenmaske auf ein Substrat aufgebracht (linkes Bild). Es entstehen dreieckige Hohlräume, in die das gewünschte Material abgeschieden wird. Nach Entfernen der Sphären bleibt ein hexagonales Wabengitter als Negativ auf der Oberfläche zurück (rechtes Bild). Durch Änderungen der Schattenmaske lassen sich das entstehende Muster und dessen opto-elektronische Merkmale nahezu beliebig variieren und erlauben z.B. die Herstellung neuartiger photonischer Bauelemente.

Genau dafür suchen wir dich!



Deine Aufgaben:

- Kennenlernen und Optimieren des Herstellungsverfahrens
- Entwicklung neuer Maskenmodifikationen
- Integration in neue opto-elektronische Bauteile (z.B. OLEDs)

Anforderungen:

- Handwerkliches Geschick
- Eigenständiges Arbeiten
- ... und natürlich Spaß am Experimentieren!

Kontakt:

Maximilian Rödel

Email: maximilian.roedel@uni-wuerzburg.de

Raum: C039c

Prof. Dr. Jens Pflaum

Email: jpflaum@physik.uni-wuerzburg.de

Raum: E09 (ZEF)